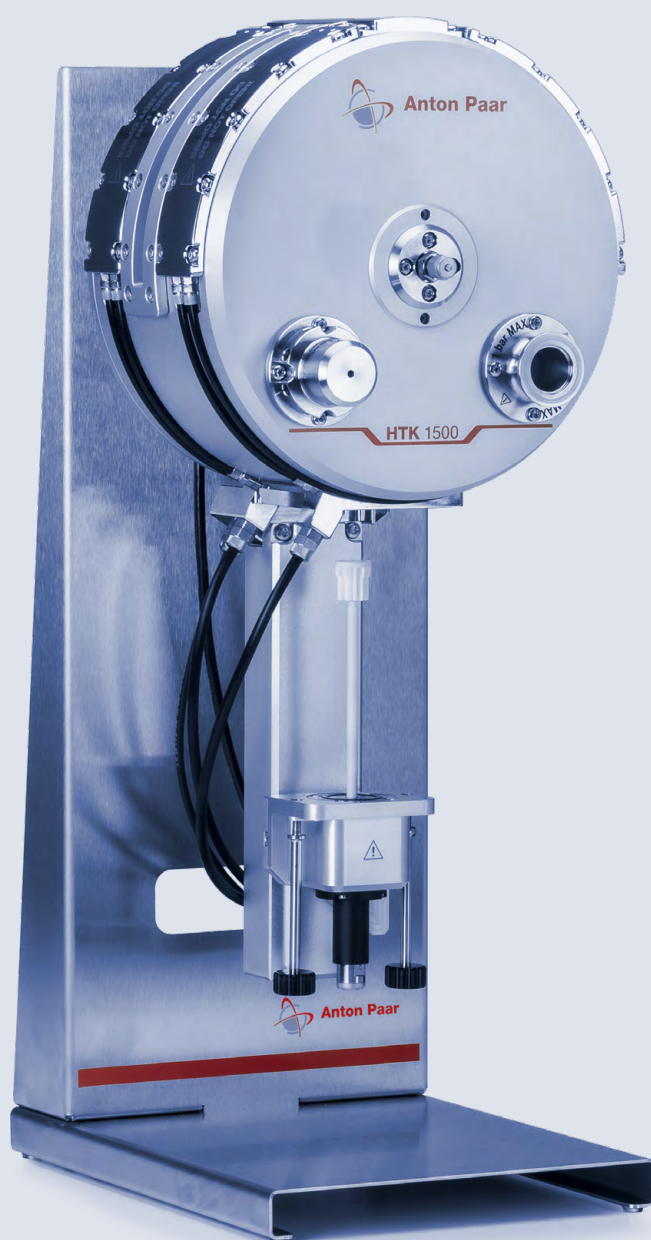


非環境 XRD 附件

HTK 1500 高溫熔爐室



瞭解更多資訊



HTK 1500 超越了「真正的」環境加熱器，在不影響精確度的情況下保證了最高溫度。

[www.anton-paar.com/
apb-htk-1500](http://www.anton-paar.com/apb-htk-1500)



HTK 1500 高溫室是 X-射線衍射 (XRD) 環境加熱器的新標準。它允許您均勻加熱所有類型的樣品材料,包括結晶粉末和散裝樣品,溫度高達 1,500 °C。加熱棒的位置加上高精確度的溫度測量,使 HTK 1500 成為唯一高達 1,500 °C 的「真正」環境加熱器。

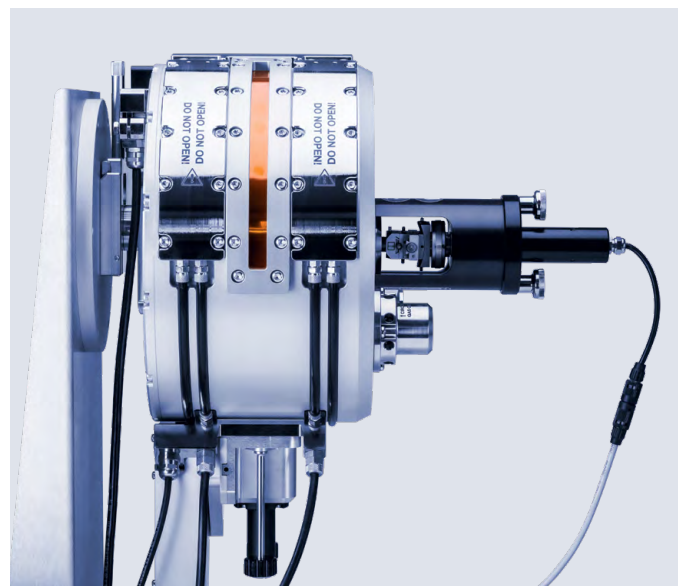
HTK 1500 高溫室是需要以優異的精確度測量高溫的 XRD 實驗的最佳選擇。

應用:

- 定義晶格參數與熱膨脹係數
- 測量溫度引起的相變和化學反應
- 觀察退火、燒結、煅燒過程等

功能與優勢:

- 環境加熱器設計可在 25 °C 至 1,500 °C 的溫度範圍內實現均勻的溫度分佈,並透過樣品架內的熱感測器進行精確的溫度測量
- 有助於從反射模式快速轉換為傳輸模式,以測量空氣敏感的及/或使用毛細管延伸的有機粉末
- 樣品架法蘭附有滑塊的優質設計可確保輕鬆處理和快速更換樣品
- 化學惰性樣品載體可支援多種樣品類型
- 腔室設計和高耐化學性材料的使用允許使用者在不同的氣體環境中進行測量
- 樣品旋轉選項可提供最高品質的 XRD 數據
- 由於無縫整合到 XRDynamic 500 和 XRDdrive 控制軟體中,透過自動識別和自動(重新)對準以保證高度自動化



HTK 1500



溫度範圍	25 °C 至 1,500 °C
壓力範圍	10 ⁻¹ mbar 至 0.5 bar 相對值
空氣	空氣、真空、惰性氣體
樣品類型	粉末、散裝樣品
樣品載體材料	剛玉 (惰性)
X-射線幾何	反射和透射